

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

KARTA PRZEDMIOTU

obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Kierunek studiów: Nanotechnologie i Nanomateriały

Profil: Praktyczny

Forma studiów: stacjonarne

Kod kierunku: NtiNm

Stopień studiów: I

Specjalności: Inżynieria nanostruktur

1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE

NAZWA PRZEDMIOTU	Podstawy prawa własności intelektualnej i przemysłowej
NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU ANGIELSKIM	basics of intellectual property law
KOD PRZEDMIOTU	WIMiF NTINM pIS B18 21/22
KATEGORIA PRZEDMIOTU	Przedmioty podstawowe
LICZBA PUNKTÓW ECTS	1.00
SEMESTRY	2

2 RODZAJ ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN W PLANIE STUDIÓW

SEMESTR	WYKŁAD	ĆWICZENIA	LABORATORIUM	LABORATORIUM KOMPUTERO- WE	SEMINARIUM	PROJEKT
2	15	0	0	0	0	0

3 CELE PRZEDMIOTU

Cel 1 Poznanie systemu ochrony własności intelektualnej. Uzyskanie umiejętności w zakresie wykorzystania dokumentacji patentowej w pracy inżyniera.

4 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1 brak

5 EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK1 Wiedza Uzyskanie wiedzy dotyczącej systemu ochrony własności intelektualnej.

EK2 Umiejętności Uzyskanie umiejętności zarządzania własnością intelektualną.

EK3 Umiejętności Uzyskanie umiejętności zabezpieczania wyników badań.

EK4 Umiejętności Uzyskanie umiejętności prowadzenia poszukiwań w bazach patentowych.

6 TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁAD		
LP	TEMATYKA ZAJĘĆ OPIS SZCZEGÓŁOWY BLOKÓW TEMATYCZNYCH	LICZBA GODZIN
W1	Konstytucyjne prawo do twórczości, konstytucyjna ochrona własności, ochrona dób osobistych, kodeks cywilny składniki przedsiębiorstwa, oznaczenie przedsiębiorcy	2
W2	Prawo autorskie pojęcie utworu, prawa osobiste, prawa majątkowe, roszczenia z tytułu naruszenia prawa autorskiego, zasady ochrony, plagiat	4
W3	Patenty prawo do patentu, zasady uzyskiwania patentów, przedmioty wyłączone z patentowania, postępowanie zgłoszeniowe, rodzaje patentów, SPC, system ochrony patentów, zasady ochrony patentowej, roszczenia z tytułu naruszenia patentu, sprzeciw, unieważnienie patentu, ograniczenia prawa z patentu, licencje, budowa opisu patentowego	4
W4	Znaki towarowe co to jest znak towarowy, zasady ochrony, systemy ochrony znaków towarowych, postępowanie zgłoszeniowe, zasady ochrony znaków towarowych, roszczenia w przypadku naruszenia znaku towarowego, sprzeciw, unieważnienie znaku towarowego - 2 Klasyfikacje, rejestry, poszukiwania w bazach danych	2
W5	Klasyfikacje, rejestry, poszukiwania w bazach danych	1
W6	Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji, ochrona know-how, ochrona oznaczenia przedsiębiorcy, ochrona produktu	2

7 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

N1 Wykład

N2 prezentacja multimedialna

N3 Dyskusja

N4 materiały dostępne na platformie e learningowej

8 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI	ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:	
Godziny wynikające z planu studiów	15
Konsultacje przedmiotowe	7
Egzaminy i zaliczenia w sesji	0
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:	
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury	0
Opracowanie wyników	0
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji	8
SUMARYCZNA LICZBA GODZIN DLA PRZEDMIOTU WYNIKAJĄCA Z CAŁEGO NAKŁADU PRACY STUDENTA	30
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU	1.00

9 SPOSOBY OCENY

OCENA FORMUJĄCA

F1 Uczestnictwo w wykładach

F2 Praca pisemna

F3 Zaliczenie pisemne

OCENA PODSUMOWUJĄCA

P1 Ocena 1

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

W1 Uczestnictwo w zajęciach

W2 złożenie pracy pisemnej

W3 Zaliczenie pisemne

KRYTERIA OCENY

EFEKT KSZTAŁCENIA 1	
NA OCENĘ 2.0	Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym.

NA OCENĘ 3.0	Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie poprawnej pracy pisemnej obejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną lub zarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo odpowiedź poprawna na co najmniej połowę pytań podczas zaliczenia pisemnego.
NA OCENĘ 3.5	Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł, lub poprawna odpowiedź na co najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach
NA OCENĘ 4.0	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybranezagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawnaodpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza sięnieobecność na trzech wykładach.
NA OCENĘ 4.5	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie pisemnym.Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.
NA OCENĘ 5.0	Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością i zrozumieniem tematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na jednym wykładzie.
EFEKT KSZTAŁCENIA 2	
NA OCENĘ 2.0	Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym.
NA OCENĘ 3.0	Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie pracy pisemnejobejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną lubzarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo zaliczenie pisemne.
NA OCENĘ 3.5	Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł, lub poprawna odpowiedź na co najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach
NA OCENĘ 4.0	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach.
NA OCENĘ 4.5	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie pisemnym.Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.

NA OCENĘ 5.0	Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością i zrozumieniem tematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na jednym wykładzie.
EFEKT KSZTAŁCENIA 3	
NA OCENĘ 2.0	Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym.
NA OCENĘ 3.0	Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie pracy pisemnej obejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną lub zarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo zaliczenie pisemne.
NA OCENĘ 3.5	Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł lub poprawna odpowiedź na co najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach
NA OCENĘ 4.0	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach.
NA OCENĘ 4.5	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.
NA OCENĘ 5.0	Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością i zrozumieniem tematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na jednym wykładzie.
EFEKT KSZTAŁCENIA 4	
NA OCENĘ 2.0	Brak uczestnictwa w co najmniej połowie wykładów lub brak złożenia poprawnej pracy pisemnej opisującej wybrane zagadnienie lub brak co najmniej połowy poprawnych odpowiedzi na sprawdzianie pisemnym.
NA OCENĘ 3.0	Uczestnictwo w co najmniej połowie wykładów i złożenie pracy pisemnej obejmującej co najmniej dwie strony A4 na temat związany z ochroną lub zarządzaniem szeroko pojętą własnością intelektualną albo zaliczenie pisemne.
NA OCENĘ 3.5	Uczestnictwo w wykładach i złożenie poprawnej pracy pisemnej o objętości co najmniej dwóch stron A4, ze wskazaniem źródeł lub poprawna odpowiedź na co najmniej 60% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach

NA OCENĘ 4.0	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 70% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na trzech wykładach.
NA OCENĘ 4.5	Uczestnictwo w wykładach i praca pisemna o objętości co najmniej dwóch stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na dwóch wykładach.
NA OCENĘ 5.0	Uczestnictwo w wykładach i praca wyróżniająca się dojrzałością i zrozumieniem tematu o objętości co najmniej pięciu stron A4, w pełni poprawna merytorycznie i stylistycznie, wyczerpująco opisująca wybrane zagadnienie, poprawny dobór źródeł i ich poprawne cytowanie lub poprawna odpowiedź na co najmniej 90% pytań na sprawdzianie pisemnym. Dopuszcza się nieobecność na jednym wykładzie..

10 MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU

EFEKT KSZTAŁCENIA	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO SZCZEGÓŁOWYCH EFEKTÓW ZDEFINIOWANYCH DLA PROGRAMU	CELE PRZEDMIOTU	TREŚCI PROGRAMOWE	NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE	SPOSOBY OCENY
EK1	K1_W15 K1_U12 K1_K09	Cel 1	W1 W2 W3 W4 W5 W6	N1 N2 N3 N4	F1 F2 P1
EK2	K1_W13 K1_W14 K1_W15 K1_U12	Cel 1	W3	N1 N2 N3	F1 F2 P1
EK3	K1_W15 K1_U12	Cel 1	W2 W3 W4 W5 W6	N1 N2 N3 N4	F1 F2 P1
EK4	K1_W15 K1_U12	Cel 1	W3 W4 W5	N1 N2 N3	F1 F2 P1

11 WYKAZ LITERATURY

LITERATURA PODSTAWOWA

[1] Joanna Sieńczyło-Chlabicz red. — *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa, 2018, WoltersKluwer Polska

12 INFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTĘ

dr inż. Andrzej Osak (kontakt: aosak@pk.edu.pl)

13 ZATWIERDZENIE KARTY PRZEDMIOTU DO REALIZACJI

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)